最近の研究から

長期利用課題報告3

サイト選択原子イメージングを基盤技術とした

蛍光 X 線・光電子ホログラフィーの相乗利用研究領域の開拓・創成

名古屋工業大学 大学院工学研究科 林 好一

自然科学研究機構 分子科学研究所 松井 文彦

Abstract

特定元素周辺の原子配列を再生できる原子分解能ホログラフィーには、原子を励起するための量子ビームや検 出に用いる二次放射線の種類によって、いくつもの種類が存在する。中でも、放射光を用いる蛍光X線ホログラ フィーと光電子ホログラフィーは最も歴史が長く、技術的な蓄積も多い。しかしながら、個別に発展してきた経 緯があり、両手法を有機的に組み合わせるという試みは行われてこなかった。本長期利用課題では、サイト選択 性という高度化と、応用利用の観点から蛍光X線・光電子ホログラフィーの相乗的利用という目標を掲げた。い くつかの共通試料を観測した結果、表面・バルクという物質全体の構造評価という有効性に加え、構造精密化を 行う上で両手法がお互いの利点と欠点を補い合う重要な役割を果たし得ることが分かった。

1. 研究の目的

機能材料には、物質が機能を発現するための原子サ イト、すなわち「活性サイト」が存在する。半導体中 のドーパントや触媒の反応サイトなどがその例であ る。「活性サイト」の原子配置を理解することで、既 存材料の飛躍的な機能向上、さらには新規材料のデザ インが可能になる。従って、3次元的に「活性サイト」 を可視化する測定技術は、材料科学の発展にとって必 要不可欠なものと言える。この点、蛍光X線ホログラ フィーや光電子ホログラフィーなどの原子分解能ホ ログラフィーは、特定元素を狙い撃ちし、その周辺の 3次元原子像を表示できる。従って、3次元局所構造 解析という材料分析のニーズに最も適った手法と言 える。また、原子分解能ホログラフィーの応用研究は 日本が群を抜いて多く、技術的にも世界トップにある。 一方、バルク測定に向く蛍光X線ホログラフィーと表 面観測に向く光電子ホログラフィーは、中距離構造解 析技術としての類似性があるにも関わらず、本長期利 用課題が始まる以前は、各々の計測に適した測定試料 を選んで研究されてきた経緯がある。このような歴史 的背景は、日本のグループが主導し、本格的に「原子 分解能ホログラフィー」を開始した当初来、光電子・ 蛍光 X 線それぞれの手法の特性を出しやすいデモン

ストレーション的な実験に留まっていた事情があり、 原子分解能ホログラフィーのさらなる展開を阻んで きた。そこで、本長期利用課題では、材料開発の立場 に立ち、真に知りたい構造情報を、蛍光X線ホログラ フィー^{III}、そして光電子ホログラフィー^{I2I}の両者を駆使 することによって導き出すことを第一義の目標とした。

原子分解能ホログラフィーは、元々、元素選択的な 構造解析法であるが、この相乗利用を推し進める上で、 サイト選択的な解析も重要なポイントである。高機能 材料の多くが複雑な構造を持ち、機能を司るドーパン トも複数の状態を持ち得る場合がある。このような対 象に対しても的確に局所構造解析を行うためのサイ ト選択ホログラフィー技術の開発も、本長期利用課題 の目標の一つとした。特に課題の前半では、このサイ ト選択技術の開発に主眼を置いている。

2. サイト選択技術の開発

 3.1 新型蛍光 X 線ホログラフィー装置開発と LPSO Mg 合金の測定

先端材料やバイオ系試料は、mm サイズの単結晶試 料を得ることが困難なものも多く、その測定のために はマイクロビームと光軸調整技術が必要となる。 BL39XU や BL13XU で蛍光 X 線ホログラフィー測定



図1 (a) 新型蛍光 X 線ホログラフィー装置及び LPSO Mg 合金の写真。(b) Zn 周辺の原子像。(左:実験値、 右:理論値)。(c) 原子像強度の実験値及び理論値の比較。

する場合、K-B ミラーや屈折レンズによる集光で、数 µm 程度のビームを利用することが可能である。新型 蛍光X線ホログラフィーには、試料位置微調整用の小 型3軸ステージが実装されている。さらに、高解像度 カメラ (ARTRAY 社、1000MI-WOM) を実装し、マ クロズームレンズと組み合わせることで5µm 程度の 分解能で、試料表面を観察可能となり、タンパク質結 晶や20 µm 程度のスピンデバイスの測定も可能とな った¹³。図 1(a)に示す本装置を用いた応用研究の一つ として、長周期積層秩序(LPSO)構造 Mg 合金の測 定を行った。純 Mg は強度に乏しいが、少量の Zn と Yの添加により、同程度の延性を確保しつつ、強度が 大きく向上する。本材料における興味の対象は、LPSO 相におけるZn及びYが形成するクラスター構造であ る。本試料は単結晶を育成することができず、組織の 中の1グレイン (0.2 × 1.5 mm²) に X 線を照射し、 Znからの蛍光X線を測定することによってホログラ ム測定を行った。再生像からはクラスター内の原子像

は観測されたが、クラスター間の原子像は観測されな かった(図 1(b))。また、図 1(c)に示す強度の評価か ら、クラスター間に 0.33 Å ものゆらぎがあることが 判明した。これより、ZnY クラスター自体は強固であ るが、クラスター間の秩序はそれほど高くなく、力学 特性などに影響していることを示唆している^[4]。

2.2 イットリウム炭酸化物薄膜のサイト選択蛍光 X 線ホログラフィー

固相イットリウム酸化物は Y₂O₃が最安定相で強固 な絶縁性を示す。一方、単酸化物である YOの合成に ついての報告は皆無であった。東北大学の福村教授ら は、パルスレーザー体積法を用い、固相 YOのエピタ キシャル膜の合成に初めて成功した。YO薄膜は Y₂O₃ と異なり高い電気伝導性を示す。YO 薄膜の構造は XRDによって岩塩構造であることが示唆されているが、 決定打とはなっていなかった。また、YO 薄膜の表層 には安定相である Y₂O₃が必ず存在し、TEM の薄片試





料作製時においても容易にそれが形成され、YO 相自 体のキャラクタリゼーションを困難にしていた。我々 はYO薄膜と標準試料Y2O3薄膜のXANESを測定し、 図 2(a)に示すように、確かに YO 薄膜特有の化学シフ トがあることを確認した。また、この化学シフトを利 用して、YO 相のみに起因するホログラムの測定を行 った。図2(b)にその結果を示すが、これは入射X線エ ネルギー17.071 keV で測定したホログラムから再生 した原子像である。アーティファクトも少なく、確か に fcc 位置に Y と思われる原子像が強く再生されて いる。また、図 2(c)は、17.071 keV 及び 17.084 keV の差分ホログラムから再生した原子像であり、Y³⁺周 辺の原子像を表現している。岩塩構造の YO に比べ Y₂O₃は複雑な結晶構造を有しているため、原子像も複 雑なものとなっているが、標準試料である Y2O3 薄膜 のホログラムの結果と良い一致を示した⁵⁰。

2.3 高エネルギー分解能阻止電場型電子エネルギー 分析器の開発

(BL25SU)高エネルギー分解阻止電場型電子エネ ルギー分析器 (RFA)の開発を行った。図 3(a)に示す ように、グリッド型の電極を積層させた 2 次元表示型 電子エネルギー分析器であり、エネルギー分解能を向 上させるための構造や配置についての最適設計を行 った。装置エネルギー分解能については実測値で E/Δ E = 1,100 を達成した¹⁰。本装置については、現在、特許を出願中である。これに関して利用面からの装置開発とその評価を行った。その後 MoS₂や TaS₂などの層状物質に適用し、性能の確認などを行いつつ、ユーザー利用できるまで、整備を進めた。本分析器を用いて、実際に利用研究が既に行われており、高エネルギー分解能で測定できることから、今後、サイト選択的な測定に利用できると考えている。

3. 融合研究

3.1 超伝導グラファイト層間化合物

グラファイトに K を挿入すると 136 mK で超伝導 転移するが、Ca を僅かにでも挿入すると 10 K を超 える超伝導転移温度を示す。XRD 測定からは、KC₈に 僅かに Ca を混ぜても KC₈構造が保たれることが分か っている。しかしながら、興味深いことに超伝導転移 温度は急激に上昇するのである。2 元金属挿入 GIC 超 伝導体(Ca_{*}K_{1*}C_y)の劈開面で光電子ホログラムを測 定したところ、回折模様が現れる場合には Ca が表面 で検出されないことが分かった。これは Ca 原子がグ ラフェン層と強く結合し、濃度のムラで Ca がほぼな い層が選択的に劈開されるようである。図4に示すよ うに、ホログラフィーによる構造解析結果から KC₈の 表面第1層のグラファイト層間距離は 0.57 ± 0.03 nm と見積もられた。理論計算と比べ、僅かに大きめ に出る傾向が分かった⁷⁷。



 図3 (a) RFA 装置概略図。(b) RFA のエネルギー分 解能。(c) 市販電子エネルギー分析器の分解能。
(d) MoS₂の 4p の光電子ホログラム。



図4 CaK 合金を挿入した黒鉛からの光電子ホログラ ムと原子再生像。原子構造モデルを合わせて示し た。Caのない部分が選択的に劈開される⁽⁷⁾。

上述のように、光電子ホログラフィーでは Ca の検 出ができなかったため、同試料の蛍光X線ホログラム の測定を行った。光電子ホログラフィーの測定は高真 空下で行われるため問題にならなかったが、大気暴露 によって試料酸化が進行する。このため、グローブボ ックス内でカプトン膜による試料のシールを行い、Ca 及びKの蛍光X線ホログラムの測定を行った。KC。と CaC₆の結晶構造には大きな違いがあるため、どちら の構造を有しているかに興味が持たれている。図 5(a) に Ca-K α XFH より再生した中心元素 Ca を含む (001)面の原子像を示す。図中には CaC₆構造で予想さ れる位置を〇で示した。比較的強いアーティファクト も観測されるが近接原子は一致しており、Ca 周辺の 構造は CaC。構造を形成していることが判明した。 図 5(b)に、K-Kα XFH より再生した中心元素 K を含む (001)面の原子像を示す。KC。構造の場合に予想される 位置を○で示している。第1近接の K 原子はほとん ど観測されないが、それより遠方には〇内に原子像が 見られ、K 周辺の構造は KC。構造となっていると考え られる。この結果は光電子ホログラフィーの結果と一 致する。Ca は K とランダムに置換しているのではな く、ある程度偏って存在していることが予想される。



図 5 (a) Ca-Kα XFH の再生像。CaC₆における Ca 元 素の位置を〇で示した。(c) Ca-Kα XFH の再生 像。KC₈における K 元素の位置を〇で示した。

3.2 トポロジカル絶縁体 Ag ドープ Bi₂Se₃

Ag:Bi₂Se₃は、トポロジカル絶縁体の一種であり、Ag 添加によるホールドープ効果によってフェルミ準位 を制御可能である¹⁸。これは、Ag⁺が Bi³⁺に置換するこ とが前提とされているが、Ag が Se-Se 層間に侵入し た方が安定であるともされている。また、ある程度の 濃度以上でフェルミ準位や電気抵抗に変化がないこ とも分かっており、置換以外のサイトも存在すること が想定される。そこで、光電子ホログラフィーと蛍光 X 線ホログラフィーを駆使し、Ag の局所構造につい て議論する。ここでは共通試料として Ag 5%の Ag:Bi₂Se₃を用いた。

光電子ホログラフィーの実験を行うために、試料を 劈開する必要があるが、真空劈開を行ったサンプルで は、大気劈開したサンプルに比べて Ag 3d のピーク 強度が1桁ほど小さくなった。これは、真空下では、 Ag 濃度が低い層で劈開されやすいためと考えられ、 ホログラム測定にも影響を与えることが想定される。 図6に、(a) Bi、(b) Se、(c) Ag の光電子ホログラム模 様を示す。Ag のパターンには、置換先と考えられる Biサイトからの前方収束ピークも観測されており、あ る程度の Ag は Bi と置換していることが確認された。 一方で、強く観測されるライン状のパターンは置換モ デルでは説明できず、Se-Se 層間侵入が強く示唆され る。この侵入サイトには、6配位サイトと4配位サイ トが存在するが、(d)に示すように、シミュレーション を行った結果、4配位サイト構造モデルによって実験 結果がある程度再現されることが分かった。

次に、蛍光 X 線ホログラフィーの結果を図 7 に示 す。Ag が Bi と置換している場合、z = 0.0 Å の再生 面の所定の位置に原子像が現れるはずであるが、ほと んど観測されず、Ag 周辺は大きく格子が歪んでいる



図 6 Ag:Bi₂Se₃からの(a) Bi 4f、(b) Se 3d、(c) Ag 3d の光電子ホログラム。(d) 4 配位サイトのシミュレーション。



図 7 (a) z = 0.7 Å の原子像、及び、(b) 想定される置換型原子配列。(c) z = 2.9 Å の原子像、及び、(d) 想定 される侵入型原子配列。

ことが示唆される。むしろ、図 7(a)に示すように、高 さのやや異なる z = 0.7 Å の位置にそれらしき像が現 れた。この結果は図 7(b)に示すように、Ag は Bi に対 して c 軸方向に僅かにずれて置換していることを示 している。また、Ag が図 7(d)のように Se-Se 層間に 侵入している場合、z = 2.9 Å 付近の面に原子像が現 れると考えられる(置換型であれば原子像は存在しな い筈である)。図 7(c)から、光電子ホログラフィーか ら予測された4配位サイトだけではなく、6配位サイ トを想定した場所にも原子像が観測されることが分 かる。6配位サイトについては、Mn:Bi₂Te₃における Mn の侵入サイトにおいても観測されている。

3.3 トポロジカル絶縁体 In ドープ Bi₂Se₃

In:Bi₂Se₃も同様にトポロジカル絶縁体であるが、In の添加量を変えることによってトポロジカル相転移 が生じる。トポロジカル相転移とは、バルクのギャッ プが一度閉じてバンド反転した後に再びギャップが 開く現象であり、In_xBi_{2x}Se₃では、 $x \approx 3-7\%$ でトポロ ジカル相転移が起こることが実験的に確認されてい る。一方、第一原理計算に基づいたトポロジカル相転 移点の見積もりは、 $x \approx 12.5\%$ となっており、実験値



図8 In:Bi₂Se₃からの光電子ホログラム。(a) Bi 4f、 (b) Se 3d、(c) In MNN。

と大きく異なっている。計算は、In が Bi とランダム に置換していると仮定しているが、In の占有サイトに は偏りがあることが想定される。

In を 16%添加した試料に対し光電子ホログラフィ ーで測定した結果を、図8に示す。Bi、Se、In のホロ グラムパターンはいずれも酷似しており、カチオンで ある In は Bi サイトに置換されていることが示唆され る。また、Ag:Bi₂Se₃のケースと異なり、層間サイトな どにほどんど侵入しないことも分かった。

一方、In を 18%添加した試料に対して、蛍光 X線 ホログラフィーによって得られた原子像を図 9 に示 す。理論計算には明瞭に再生されている近接の Bi 原 子像は、実験データには観測されない。このため、In 周辺の局所構造は、本来の Bi₂Se₃の格子から大きく変 調していると考えられる。また、In は分散して置換す るより、隣り合って置換する方がエネルギー的に安定



図 9 蛍光 X 線ホログラフィーから得られた In 周辺の原子像。(左)実験値。(右)計算値。

であることが第一原理計算によって予測されている。 もし、そのような状態になっているのであれば、Biより も原子番号の小さな In の像は弱く再生されるため、本 結果は、そのような状態を反映している可能性がある^同。

4. まとめ

本長期利用課題(2015A0116~2017B0116、 2015A0124~2017B0124, 2016A0128~2017B0128) では、原子分解能ホログラフィーのサイト選択性とい う高度化に取り組み、特に後半期には、蛍光X線ホロ グラフィーと光電子ホログラフィーの相乗研究を推 し進めた。本稿では特に、超伝導グラファイト層間化 合物、トポロジカル絶縁体のドーパントの解析結果に ついて紹介した。当初は、蛍光X線ホログラフィーは バルク敏感、光電子ホログラフィーは表面敏感という 特徴を相補的に利用するというアイデアしかなかっ た。しかしながら、同一試料の測定から、両ホログラ ムに含まれる物理情報の性格は大きく異なり、有効に 相互利用することにより正しく構造を導けることが 分かった。例えば、大きな格子歪みを有するトポロジ カル絶縁体は、原子ゆらぎに敏感な蛍光X線ホログラ フィーのみでは、鮮明な原子像が得られないため構造 決定が困難である。そこに、光電子ホログラフィーの 結果が適切なガイド役を果たすことよって、正確な局 所構造の描像が見えてくる。この点は、本連携研究の 大きな収穫であったと言える。一方で、開発したサイ ト選択技術をうまく相乗研究に乗せられると良かっ た。この取り組みには、もう少し時間が必要と感じる。

謝辞

本長期利用課題研究を遂行するにあたり非常に多 くの研究者の協力を得た。特に本稿の成果を上げる上 で、奈良先端科学技術大学院大学 大門寛氏、JASRI 松下智裕氏、同 室隆桂之氏、同 田尻寛男氏、同 鈴木 基寛氏、同 水牧仁一朗氏、同 中村哲也氏、広島市立 大学 八方直久氏、熊本大学 細川伸也氏、名古屋工業 大学 木村耕治氏、ドイツ放射光施設 Jens Stellhorn 氏には、放射光実験及び解析において協力を得た。ま た、岡山大学 久保園芳博氏、東北大学 福村知昭氏、 モスクワ州立大学 Lada V. Yashina 氏には、最先端 の試料を提供して頂いた。

参考文献

- [1] K. Hayashi and P. Korecki: J. Phys. Soc. Jpn. 87 (2018) 061003.
- [2] F. Matsui et al.: Catalyst & Catalysis 59 (2017) 76-81.
- [3] N. Happo et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 57 (2018) 058006.
- [4] T. Nishioka et al.: Materialia 3 (2018) 256-259.
- [5] J. R. Stellhorn et al.: J. Appl. Cryst. 50 (2017) 1583-1589.
- [6] T. Muro et al.: Rev. Sci. Instrum. 88 (2017) 123106.
- [7] F. Matsui et al.: Sci. Rep. 6 (2016) 36258.
- [8] T. He et al.: Phys. Rev. B 97 (2018) 104503.
- [9] K. Kimura et al.: Surf. Interface Anal. 51 (2019) 51-55.

林 好一 HAYASHI Koichi

名古屋工業大学 大学院工学研究科 〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町 TEL:052-735-5308 e-mail:khayashi@nitech.ac.jp

<u>松井 文彦 MATSUI Fumihiko</u>

自然科学研究機構 分子科学研究所 〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38 TEL:0564-55-7201 e-mail:matui@ims.ac.jp